

1 はじめに

透過電子顕微鏡(transmission electron microscopy, TEM)は、像観察や電子回折を通して試料の形態や構造の解析を行う装置であり、さらに、エネルギー分散型 X線分光法(energy dispersive X-ray spectroscopy, EDS) や電子エネルギー損失分光法(electron energy loss spectroscopy, EELS)などの各種分光法と組み合わせる ことで組成分析や化学状態解析も可能である. TEM で は様々な情報が得られることからその応用範囲は広く、 無機材料、金属材料、高分子材料や生体物質などの評価 に広い分野で使用されてきた. TEM の装置、測定手法 および解析法の発展は著しく、今後もその利用は拡大す ると思われる.

TEM による構造評価が有効な材料に固体触媒がある. 固体触媒は,化学品製造,エネルギー変換,排ガス浄化 などの広い分野で化学反応を迅速かつ選択的に進行させ るために使用されており,また,現在課題となっている カーボンニュートラルの実現に向けて新規触媒材料の開 発が盛んに行われている.固体触媒の開発には,固体触 媒の構造と性能の関係を明らかにすることが重要であ り,触媒性能を左右する触媒活性成分や欠陥構造を原子 レベルで直接観察できる TEM は,固体触媒の研究には 欠かせない手法となりつつある.

近年,固体触媒材料を原子レベルで観察する際に,従 来の高分解能透過電子顕微鏡法(high-resolution transmission electron microscopy, HRTEM)に加え,走査透 過電子顕微鏡法(scanning transmission electron microscopy, STEM)が適用される例が増えてきた.それぞれ 長所短所があり,試料と観察目的に合った方法を選択す るために,これらの特徴を知っておくことは有用であ る.本稿では,固体触媒材料の高分解能観察を例に, HRTEM や STEM の特徴について解説する.

2 HRTEM による観察

2・1 高分解能像が形成される過程

図1に HRTEM において高分解能像が形成される過 程を示す. HRTEM では平行に近い電子線を試料の観察 領域に同時に照射する. 試料に入射した電子は、試料を 透過する際に直進する電子(ここでは透過波とする)と 散乱電子に分かれる. 試料が結晶性物質の場合, Bragg の条件を満たす方向に回折波が生じ、対物レンズの後焦 点面で、回折の方向と角度ごとに電子が収束し回折パ ターンが形成される. さらに像面において、透過波と回 折波が干渉することによって高分解能像が形成される. 回折パターンの中央の明るいスポットは透過波によるも のであり、中央のスポットと回折スポットとの距離は回 折を起こした結晶面の面間隔の逆数に比例する. 面間隔 の狭い結晶面からは中心から離れた位置に回折スポット が生じ、像面で周期の短い格子縞が生じる. 面間隔の広 い結晶面ではこの逆となる. このように生じた様々な周 期と方向の格子編が重なり合い. 高分解能像が形成され る.



図1 通常の TEM における高分解能像の形成過程(図中の回 折パターンと高分解能像は金薄膜を試料として取得)

Hight-resolution Observation of Solid Catalysts Using Transmission Electron Microscopy.

2・2 HRTEM の特徴─Y型ゼオライトの観察を例と して─

高分解能像に影響を与える因子として、①照射電子線 に対する結晶の方位、②試料の厚さ、③対物レンズの焦 点、④電子照射による試料損傷などがある. ここでは、 Y型ゼオライトのHRTEM 観察を例に、高分解能像に影 響する因子について述べる. ゼオライトは結晶性の多孔 質アルミノケイ酸塩の総称であり、中でもY型ゼオラ イトは石油精製過程で得られる重質油をガソリンに変換 する流動接触分解(fluid catalytic cracking, FCC)プロ セスの触媒として使用されるなど、工業的に重要なゼオ ライトの一つである. 図2に示すように、Y型ゼオライ トはSiO₄ および AlO₄ 四面体によって形成される2種 のビルディングユニット(sod および d6r)が六員環を







図3 (a) [110] 方向に投影したY型ゼオライトのTサイト (Si あるいはAl)の位置. 黒点は [110] 方向(紙面に対 して垂直方向)にTサイトが重なった原子カラムの位置 である. (b)Y型ゼオライトの [110] 照射の電子回折パ ターンのシミュレーション. (c) (b)からz軸を回転軸 として結晶を3°回転させた場合の電子回折パターンのシ ミュレーション

共有して交互に連結した構造を有しており、細孔口径 0.74 nm のゼオライトの中でも大きな細孔を有する特徴 を持つ.

① 照射電子線に対する結晶方位の影響

結晶性物質の結晶構造を観察する場合、入射電子線の 方向に,結晶の低指数方向を合わせることが重要とな る.図3(a)に示すように、立方晶構造を有するY型 ゼオライトでは[110] 方向(紙面に垂直方向)にTサ イト(Si あるいは Al の位置)が一列に並んでいること から、[110] 方向が高分解能観察に適した入射方向の 一つである.結晶の方位合わせは、サンプルを任意の方 向に傾斜できる二軸試料ホルダを用い、電子顕微鏡を回 折モードにして回折パターンを観察しながら行う.この 際、目的の方位の電子回折パターンをあらかじめシミュ レーションしておくことが望ましい.結晶方位が低指数 方向に合った場合、多数の回折スポットが現れる(Y型 ゼオライトの[110]入射の場合は図3(b)のようなパ ターンが現れる).低指数方向より方位がずれると回折 スポットの数は少なくなる. 例えば、図3(c) に示す ように、Y型ゼオライトの結晶を [110] 入射射からz 軸を回転軸に回転させていくと、001に指数付けされる 一列のスポットを残して、他の回折スポットが消える. このような回折パターンの状態で得られる高分解能像 は、一方向にしか格子縞がない像となる.

図4は方位調整を行わずに撮影したY型ゼオライト の高分解能像の一例である.この像では結像に関与する 回折波が少ないため一方向の格子編しか見ることができ ない.一方,図5(a)は[110]入射に方位合わせを 行ったY型ゼオライトの高分解能像¹⁾である.方位合わ せを行った像からは細孔の配列など結晶構造に関する情 報が得られる.高分解能像を高速フーリエ変換(fast fourier transform, FFT)することにより,回折パターン と類似した FFT パターンが得られ,高分解能像がどの ような周期性を有しているかわかる(図5(b)).高分 解能観察の目的の一つに結晶の欠陥構造の評価があり, 結晶方位合わせを行って得た像からはより詳細な欠陥構 造に関する情報が得られる(図6).



図 4 方位調整を行わずに撮影した Y 型ゼオライトの HRTEM 像の一例



図 5 (a) Y型ゼオライトの [110] 入射の HRTEM 像¹⁾. 加速 電圧 200 kV, 球面収差係数 Cs = 1 mm の電子顕微鏡で撮 影. (b) HRTEM 像 (a) の高速フーリエ変換. (c), (b) HRTEM 像 (a) の領域 c および d の拡大像. 結晶の厚 さは c < d である. (e) HRTEM 像 (c) および (d) の Si (or Al) の位置. (f) Y型ゼオライトの [110] 入射の シミュレーション像. 加速電圧 200 kV, 球面収差係数 Cs = 1 mm, 結晶の厚を 7 nm (単位格子 2 つ分の厚さ) として計算



図6 Y型ゼオライトの双晶界面(白矢印)

② 試料の厚さの影響

図5(a)の高分解能像はY型ゼオライト粒子の縁を 撮影したものであり、像の上部に向かうほど結晶が厚く なっている.結晶の薄い部分の拡大像(図5(c))はSi あるいはAlの位置(図5(e))に対応する場所に黒い スポットが認められ、結晶構造を反映した像となってい る.一方、結晶の厚い部分の拡大像(図5(d))は原子 位置とコントラストが対応していない.これは,結晶が 厚い部分では,電子が試料中を透過する際の多重回折の 影響が大きくなるためと考えられる.電子回折では試料 の厚さにより回折スポットの強度が大きく変化し,した がって回折波の干渉により形成される高分解能像も試料 厚さの影響を受ける.HRTEM で結晶構造を反映した構 造像を得が得られるのは,多重散乱の影響の少ない薄い 部分のみである.

③ 対物レンズの焦点の影響

電子顕微鏡では電磁レンズである対物レンズに流す電 流量で焦点距離を調整できる.焦点距離を変化させると 透過波と回折波の干渉にも影響し像のコントラストが変 化する.原子位置に対応したコントラストを得るには, 試料に焦点があった状態からの焦点はずし量を次式で与 えられるシェルツァー・フォーカス (Δf_{Scherzer}) に設定 するのが良いとされている.

$$\Delta f_{\rm Scherzer} = -\sqrt{\frac{3}{4}} C_{\rm s} \lambda$$

ここで、 C_{α} は対物レンズの球面収差係数であり、 λ は加 速電圧で決まる電子波の波長である(加速電圧 200 kV では 2.51 pm). 図5 (f) は異なった焦点はずし量で計 算したY型ゼオライトのシミュレーション像であるが. シェルツァー・フォーカスである焦点はずし量-60 nm の像ではTサイトの位置(図5(e))に暗いスポットが あり、結晶構造と対応したコントラストが計算される (この像は実際に得られた図5(c)の像と対応してい る). 一方, 焦点はずし量が-40 nm や-80 nm ではコ ントラストが実際の原子配列に対応しておらず、特に焦 点はずし量-80 nm の像では T サイトの一部が明るい スポットとなっておりコントラストが反転していること がわかる. この例に示すように、HRTEM で原子位置を 反映した像を得るためには、微妙な焦点の設定が必要と なる.実際の HRTEM 観察では焦点の影響や先に述べ た試料の厚さの影響により、原子位置を反映した像が得 られることが少ない.結晶構造を同定するためには焦点 や厚さを変化させた場合の像のシミュレーションを行 い. 実際に得られた像と比較することが必要となる. ④ 電子照射による試料損傷について

固体触媒材料には電子照射に弱い材料も多く, ゼオラ イトはその代表的なものである. ゼオライトの場合, 電 子線を照射しすぎると非晶質化してしまい, 本来の構造 を観察できなくなる. 電子線に弱い材料の観察時の工夫 としては, 視野探しや結晶方位の調整をできるだけ電子 線照射の少ない(視野が暗い)条件で行うことや, 撮影 時の倍率, 電子線照射量(明るさ)やカメラの露光時間 等の条件をあらかじめ決めておくことなどが挙げられ る.

3 STEM による高分解能観察

3·1 STEM の概要

近年,固体触媒のキャラクタリゼーションに STEM が用いられることが多くなってきた. その理由として. 単一原子を観察できる高い分解能をもった球面収差補正 STEM の装置が普及してきたこと, HRTEM より像の解 釈が容易であること、EDS などの元素分析装置と組み 合わせることにより元素マッピングが可能であることな どが挙げられる.図7に示すように、STEMでは集束さ せた電子線を試料上で走査する. STEM での電子線照射 は走査電子顕微鏡(SEM)と類似しているが, SEM で は試料上方の反射電子や二次電子を検出するのに対し. STEM では透過電子や散乱電子で結像し構造を観察す る. 透過電子を検出する明視野法 (bright field (BF)-STEM) で得られる像は、基本的には HRTEM と同じで ある.一方, 散乱電子を検出する環状暗視野法 (annular dark field (ADF)-STEM) では、HRTEM で問題となる 焦点はずし量や試料厚さによるコントラストの反転が無 い. また、散乱電子の検出角度を高角度に設定すると (high-angle annular dark field (HAADF)-STEM), 主に 非弾性散乱電子を検出することとなり、原子番号の大き







い元素種がより明るく強調された像(Zコントラスト像) が得られる.以下に種々の固体触媒材料(ゼオライト, 金属微粒子,ヘテロポリ酸塩)に HAADF-STEM 法を適 用した観察例を紹介する.

3·2 STEM による観察例

3·2·1 Y型ゼオライト

図8にY型ゼオライトをHAADF-STEM法で撮影した 像¹⁾を示す(試料は図5のHRETEM像と同じである). HAADF-STEM像では、Tサイトの位置が明るく観察さ れ、ゼオライトの骨格構造が直感的に理解できる. HRTEM像では試料の厚みとともにコントラストが大き く変化するが、HAADF像では結晶が厚くなっても信号 強度が大きくなる(明るくなる)だけでコントラストの 反転などの大きな変化は見られない.また、焦点をずら しても像がぼけるだけである.

HAADF-STEM は,軽元素からなる結晶に導入された 重金属元素の可視化に有効である.ゼオライトを固体触 媒として利用する場合,熱安定性の向上や触媒活性点の 形成を目的として,イオン交換などで重金属元素をゼオ ライト中に導入することがある.ゼオライトに導入され た重金属の位置や構造を明らかにするために,HAADF-STEM 法による直接観察が試みられている.一例として 図9に,Y型ゼオライトにLa³⁺イオン(原子番号57) をイオン交換で導入した場合のHAADF-STEM 像の変化 を示す¹⁾(一枚の像を複数に分割し重ね合わることによ り平均化したものである).イオン交換前と比べ,明る く変化した箇所がLa³⁺イオンが存在するサイトである. ここに示した像のように,ゼオライトのTサイトと導 入金属の両方が可視化された像を得ることができれば,





図9 Y型ゼオライトに La³⁺をイオン交換で導入した時の STEM 像の変化¹⁾

(左上)イオン交換前の像.図8のSTEM像を分割し、重ね合わせることにより平均化した像である.(右上)Laイオン交換後の像.同様の方法で平均化したものである.球面収差補正器を搭載した加速電圧 200kVの電子顕微鏡で撮影.

ゼオライト中の重金属原子の位置を特定することができる.

3・2・2 バイメタル微粒子

触媒活性を有する金属微粒子をシリカ、アルミナ、活 性炭などの高比表面積の担体上に固定化した担持金属触 媒のキャラクタリゼーションにも HAADF-STEM は有効 である. 担体上の金属微粒子の粒子径分布測定には通常 の TEM が利用されていたが、HAADF-STEM では原子 番号の大きな元素を高感度に検出できるため、より小さ な金属微粒子を観察すること可能で、通常の TEM では 難しかった担体上に分散した単原子状の活性種も可視化 できる.また、二種類以上の金属を活性成分とすること で触媒性能を向上させた多成分系の担持金属触媒の評価 にも STEM 法が有効である.二種の金属で微粒子を形 成させた場合、コアシェル構造、合金粒子、あるいは、 成分ごとの粒子の形成が考えられるが、HAADF-STEM 像のコントラストや EDS などの元素分析装置と STEM を組み合わせた元素マッピングにより、これらを見分け ることができる.

図 10 に二元系金属微粒子のコアシェル構造を HAADF-STEM 像のコントラストにより確認した例を示 す²⁾. 試料は,パラジウム(原子番号 46)の微粒子を塩 化白金酸溶液で処理し,微粒子表面のパラジウムをガル バニ置換反応によって白金(原子番号 78)に置換した ものである.図 10(a)のHAADF-STEM 像では,立方 晶構造を有する Pdの[110]入射により,電子線の入 射方向に積み重なった原子の列(原子カラム)を観察し ている.粒子外層に明るい原子カラムが認められること から(図 10(b)の矢印),Pd粒子外層の原子の一部が Pt に置換され,コアシェル構造が形成していることが 確かめられる.

図 11 に、EDS-STEM により、合金微粒子の形成を確認した例を示す³⁾. 試料は酸化チタンに金とパラジウムを担持した触媒である. HAADF-STEM 像のコントラストからは金属成分の分布が不明であるが、電子線を走査した際に発生する特性 X 線を測定する EDS を組み合わ



図 10 (a) Pd@Pt core-shell ナノ粒子の HAADF-STEM 像²⁾ (b) STEM 像 (a) 中の A 点から B 点までの強度プロファ イル²⁾

球面収差補正器を搭載した加速電圧 200 kV の電子顕微鏡で撮影.

せることで、金属微粒子の組成と元素分布を調べること ができる.この場合には金とパラジウムの特性 X 線が 同じ領域から検出できることから合金化が確認できる.

3・2・3 ヘテロポリ酸塩

ケギン型ヘテロポリ酸 (H_nXM₁₂O₄₀, X:Si, P など, M: Mo, W など)は、酸触媒反応や酸化反応に触媒作用 を示す (図 12). ケギン型ヘテロポリ酸のセシウム塩は、 例えばメタクリル樹脂モノマーであるメタクリル酸の製 造など、様々な反応の固体触媒として利用できる。ヘテ ロポリ酸のセシウム塩では結晶の欠陥構造が触媒性能を 左右する細孔を生じるため, 欠陥構造の評価が重要であ る。ヘテロポリ酸塩は電子線に弱いため、これまで TEM での高分解能観察が欠陥構造の評価に有効な方法 とされてこなかった. しかし, HAADF-STEM 法で観察 条件の設定を適切に行えば高分解能観察が可能であるこ とがわかってきた. 図 13 に, 多孔質のケイタングステ ン酸のセシウム塩 (Cs_xH_{4-x}SiW₁₂O₄₀) の細孔構造を可 視化した例を示す4). ケギン型ヘテロポリ酸のセシウム 塩は立方晶構造であり、[111]入射ではセシウムとケ ギンヘテロポリ酸の12個のタングステン原子が別々の



図 11 金とパラジウムを TiO₂ に 担持した 触媒の HAADF-STEM 像(上段) と EDS 元素マップ(下段) 球面収差補正器を搭載した加速電圧 200 kV の電子顕微鏡で撮影.



図 12 ケギン型ヘテロポリ酸のセシウム塩



図 13 多孔質 Cs_xH_{4-x}SiW₁₂O₄₀ の HAADF-STEM 像⁴⁾ (a) [111] 入射の高分解能像, (b) ケギンアニオンの欠損の存 在を示す像. (c) {110} 面に水平なスリット状の欠陥. 球面収 差補正器を搭載した加速電圧 200 kV の電子顕微鏡で撮影.

原子カラムとして観察できる (図 13 (a)). [111] 入射 でセシウム塩結晶を撮影し, ヘテロポリ酸の"分子カラ ム"が一つのスポットとして見えるように像にぽかしを 入れると, ヘテロポリ酸のスポット明るさにむらがある ことがわかる (図 13 (b)). これは結晶構造中にヘテロ ポリ酸アニオンの欠損構造があることを示している. ま た, {110} 面に平行にスリットが入った欠陥構造も観 察された (図 13 (c)). これらの欠陥構造により細孔が 形成されていると考えられる.

3·3 HRTEM と STEM の比較

以上で紹介した観察例のように、HAADF-STEM では

コントラストの反転がなく解釈が容易な像が得られるこ とや、組成の解析が可能であるなどのHRTEMにはな い利点がある.一方、STEMでは電子線を一点に集束し 照射するため、電子線に弱い試料の観察がHRTEMよ りも難しい一面もある.また、STEMではHRTEMに 比べ一枚の画像の取得に時間を要するため、試料のドリ フト(移動)の影響を受けやすい.結晶性物質のSTEM 撮影中に試料が移動すると、原子間の距離や結晶面のな す角度が不正確となるので注意が必要である.

4 おわりに

近年の電子顕微鏡装置は操作が容易となっており,形 態観察であれば経験が浅くても比較的簡単に(S) TEM 像を取得できる.しかし,特に結晶性物質の原子レベル での高分解能観察においては,観察条件次第で得られる 像が大きく異なることから,情報をより多く引き出すた めには適切な条件設定が必要となる.透過電子顕微鏡を 利用したくても十分な観察時間を確保することができ ず,観察を依頼することも多いと思われるが,依頼測定 を行う場合でも,得られた像を適切に解釈するために は,像に影響を与える因子を知っておくことは有用と思 われる.本稿では,触媒材料の(S) TEM 像の観察につ いて具体例を挙げて解説したが,これから(S) TEM の 観察に取り組む方や,依頼分析を検討している方の参考 になれば幸いである.

文 献

- N. Hiyoshi, T. Ikeda, Y. Hasegawa, K. Sato : *Micropor. Mesopor. Mat.*, **311**, 110711 (2021).
- M. Miyakawa, N. Hiyoshi, M. Nishioka, H. Koda, K. Sato, A. Miyazawa, T. M. Suzuki : *Nanoscale*, 6, 8720 (2014).
- N. Mimura, N. Hiyoshi, M. Date, T. Fujitani, F. Dumeignil: Catal. Lett., 144, 2167 (2014).
- 4) N. Hiyoshi, Y. Kamiya : Chem. Commun., 51, 9975 (2015).



日吉 範人 (Hrvoshi Norihito) 国立研究開発法人産業技術総合研究所材 料・化学領域化学プロセス研究部門有機物 質変換グループ (〒983-8551 宮城県仙台 市宮城野区苦竹 4-2-1 産総研東北セン ター).北海道大学大学院地球環境科学研 究科博士課程修了.博士(地球環境科学). 《現在の研究テーマ》電子顕微鏡を用いた 触媒キャラクタリゼーション.《趣味》釣り. E-mail:n-hiyoshi@aist.go.jp